

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

PACS 42.65.Dr; 42.70.Mp; 63.20.-e

Спонтанное и вынужденное комбинационное рассеяние света в кристаллах ZnWO₄

Т.Т.Басиев, А.Я.Карасик, А.А.Соболь, Д.С.Чунаев, В.Е.Шукшин

Представлены результаты исследования спонтанного и вынужденного комбинационного рассеяния в кристалле ZnWO₄ со структурой вольфрамита. Измерены поляризованные спектры спонтанного комбинационного рассеяния (КР), соответствующие всем шести независимым компонентам тензора КР. Идентифицированы частоты полного набора колебательных мод. При пикосекундовом возбуждении импульсами Nd: YLF-лазера с длиной волны излучения 1047 нм измерены энергетические пороги накачки ВКР в кристаллах ZnWO₄ и KGd(WO₄)₂. На основе измеренных порогов и спектроскопических параметров кристаллов определены коэффициенты ВКР-усиления для ZnWO₄.

Ключевые слова: спектроскопия КР, ZnWO₄, вынужденное комбинационное рассеяние.

1. Введение

Кристаллы MeWO₄ (Me = Ca, Sr, Ba, Pb, Zn) со структурой шеелита и вольфрамита широко используются при создании преобразователей частоты лазерного излучения на основе процесса ВКР и в качестве детекторов ионизирующего излучения [1–3]. Каждый из этих кристаллов имеет широкий набор колебательных резонансов и связанных с ними узких линий в спектрах спонтанного комбинационного рассеяния (КР) света со стоксовыми сдвигами частоты от 10 до $\sim 1000 \text{ см}^{-1}$. По сравнению с кристаллами, формируемыми оксиационными комплексами типа [CO₃], [NO₃], [PO₄], кристаллы вольфраматов обладают относительно высокими интенсивностями линий КР, что обуславливает большие коэффициенты ВКР-усиления в этих кристаллах. К достоинствам кристаллов вольфраматов можно отнести широкое окно прозрачности в видимой и ближней ИК областях спектра, а также большую твердость, теплопроводность и влагостойкость. В ряду указанных кристаллов менее исследованы нелинейные свойства кристалла вольфрамата цинка. Цель настоящей работы – исследования спонтанного КР и ВКР в кристалле ZnWO₄, а также сравнение параметров ВКР-усиления в этом кристалле и в известном кристалле KGd(WO₄)₂ (KGW).

2. Спектроскопия КР

Кристаллы ZnWO₄ имеют структуру вольфрамита с моноклинной пространственной группой P2/c (C_{2h}⁴) и с двумя формульными единицами в элементарной ячейке [4].

Теоретико-групповой анализ подразумевает наличие 18 колебательных мод ($8A_g + 10B_g$) в спектре КР в таком

кристалле [5]. Если выбрать такую декартову систему координат, чтобы ось z была параллельна оси второго порядка C_2 , тензоры КР для данной структуры будут иметь следующий вид:

$$\begin{vmatrix} \alpha_{xx} & \cdot & \alpha_{xz} \\ \cdot & \alpha_{yy} & \cdot \\ \alpha_{zx} & \cdot & \alpha_{zz} \end{vmatrix} \text{ для } A_g, \quad \begin{vmatrix} \cdot & \alpha_{xx} & \cdot \\ \alpha_{yx} & \cdot & \alpha_{yz} \\ \cdot & \alpha_{zy} & \cdot \end{vmatrix} \text{ для } B_g.$$

Монокристалл был ориентирован с направлением кристаллографических осей $a||x$, $b||y$, $c||z$. Поляризованные спектры КР при возбуждении излучением аргонового лазера с $\lambda = 488.0 \text{ нм}$ регистрировались со спектральным разрешением 0.6 см^{-1} спектрометром Spex-Ramalog 1403 в направлении обратного рассеяния. Поскольку в моноклинной структуре ZnWO₄ угол β практически равен 90° [4], при установке кристалла не было проблем, связанных с проявлением эффекта двупреломления. На рис.1,*a* приведены поляризованные спектры КР света в геометриях рассеяния, соответствующих всем шести компонентам тензоров КР для кристалла ZnWO₄. Это позволило надежно идентифицировать частоты полного набора колебательных мод $8A_g + 10B_g$. Частоты колебательных мод, зарегистрированных нами в спектрах КР ZnWO₄, приведены в табл.1. В частности нам удалось разделить близкорасположенные линии с симметриями A_g и B_g в областях частот $180\text{--}200$ и $260\text{--}280 \text{ см}^{-1}$ (рис.1,*b*).

Ранее в [5] также была проведена идентификация колебаний в структуре ZnWO₄. Однако авторы этой работы использовали поликристаллические образцы, непригодные для поляризационных исследований, а симметрия колебательных мод определялась на основе модельных расчётов. Это объясняет, почему в работе [5] не были зарегистрированы частоты всех колебательных мод, активных при КР для ZnWO₄; кроме того, идентификация симметрии для ряда колебаний проведена ошибочно.

Из рис.1,*a* видно, что для ВКР-преобразования представляет интерес наиболее интенсивная линия с симметрией A_g и частотой 906 см^{-1} . Из спектров спонтанного КР мы по методике работ [6–8] определили интегральное (σ_{int}) и пиковое (σ_{peak}) сечения этой линии, а также ширину

Т.Т.Басиев, А.Я.Карасик, А.А.Соболь, Д.С.Чунаев, В.Е.Шукшин.
Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Россия, 119991
Москва, ул. Вавилова, 38;
e-mail: chunaev_d@lst.gpi.ru, shukshinve@lst.gpi.ru

Поступила в редакцию 28 декабря 2010 г.

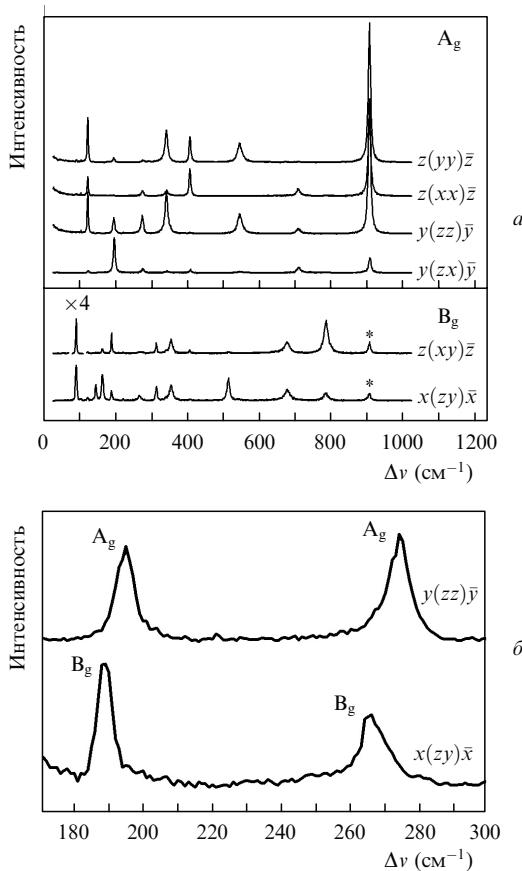


Рис.1. Поляризованные спектры КР монокристалла вольфрамата цинка в области частот до 1000 cm^{-1} (а) и в области $170 - 300\text{ cm}^{-1}$ (б) при температуре 300 К. Звёздочкой отмечены колебания, запрещенные в данной геометрии рассеяния.

Табл.1. Частоты колебаний в спектрах КР ZnWO₄ при 300 К.

Частоты колебаний (см^{-1})	
A _g	B _g
123	91
	145
	166
	190
195	267
	314
275	355
	515
342	680
	785
408	
544	
708	
906	

линией Δv_R КР, обратно пропорциональную времени фазовой релаксации T_2 КР-активного колебания.

Значения этих спектроскопических параметров для кристаллов ZnWO₄ и KGd(WO₄)₂ приведены в табл.2. В зависимости от соотношения между длительностью импульса лазерной накачки T_p и временем дефазировки T_2 может преобладать стационарный или нестационарный процесс ВКР. При переходе от стационарного к нестационарному процессу эффективность ВКР-усиления падает.

Кристалл KGW известен как наиболее эффективный материал для ВКР пикосекундных импульсов, что обусловлено малым временем дефазировки. Для этого кристалла T_2 составляет около 2 пс, так что даже при пикосекундной накачке с $T_p = 10 - 20$ пс ВКР сохраняет стационарный характер. Максимальные значения σ_{int} и σ_{peak} ВКР-активной моды для кристалла ZnWO₄ соответствуют поляризации возбуждения $E \parallel b$. Значения σ_{int} для кристаллов ZnWO₄ и KGW близки, тогда как величины σ_{peak} различаются, что обусловлено различием ширин линий КР света: для кристалла ZnWO₄ ширина линии $\Delta v_R = 7.5\text{ cm}^{-1}$, т. е. в 1.4 раза больше ширины линии $\Delta v_R = 5.4\text{ cm}^{-1}$ для кристалла KGW. Соответственно значение σ_{peak} для ZnWO₄ в 1.4 раза ниже, чем для кристалла KGW. Стационарный коэффициент ВКР-усиления g определяется пиковым сечением, и поэтому для ZnWO₄ следует ожидать его более низкого значения, чем для KGW. Однако для коротких импульсов, сравнимых по длительности с T_2 , процесс ВКР в ZnWO₄ ближе к стационарному и, следовательно, более эффективен.

3. ВКР в кристалле ZnWO₄

Процесс ВКР в кристалле ZnWO₄ легко наблюдается при пикосекундном лазерном возбуждении в ближней ИК области спектра [9]. Как показано нами в [10], при пикосекундном мощном возбуждении в зеленоой области спектра ВКР в ZnWO₄ затруднено, и порог генерации практически не достигается вследствие конкуренции этого процесса с нелинейным процессом двухфотонного поглощения. Последний препятствует достижению порога ВКР из-за существенного ограничения мощности лазерного излучения в кристалле и большого наведенного поглощения на длине волны накачки.

В работе [11] мы предложили и продемонстрировали метод измерения коэффициента ВКР-усиления, основанный на использовании в качестве источника накачки кристалла последовательности пикосекундных лазерных импульсов переменной интенсивности и на измерении пороговой энергии накачки ВКР. Сопоставление результатов измерений с результатами теории [12] позволяет определять коэффициенты ВКР усиления как для стационарного, так и для нестационарного процесса. В настоящей работе мы измерили пороговую энергию накачки ВКР в кристаллах ZnWO₄ и KGW с использованием техники, описанной в [11].

Табл.2. Спектроскопические параметры ВКР-активных мод в кристаллах ZnWO₄ и KGW, нормированные пороговые значения энергии накачки $E_{th}L$ и коэффициенты ВКР-усиления g .

Кристалл	v_R (см^{-1})	Δv_R (см^{-1})	Направление и поляризация возбуждения	σ_{int} (отн. ед.)	σ_p (отн. ед.)	$E_{th}L$ (отн. ед.)	g ($\text{см}/\text{ГВт}$)
ZnWO ₄	906	7.5	$k \parallel c, E \parallel b$	146	23	1.3	3.9
			$k \parallel c, E \parallel a$				
KGW	901	5.4	$k \parallel b, E \parallel a$	88	14	1.6	3.2
				150	31	1	5.1

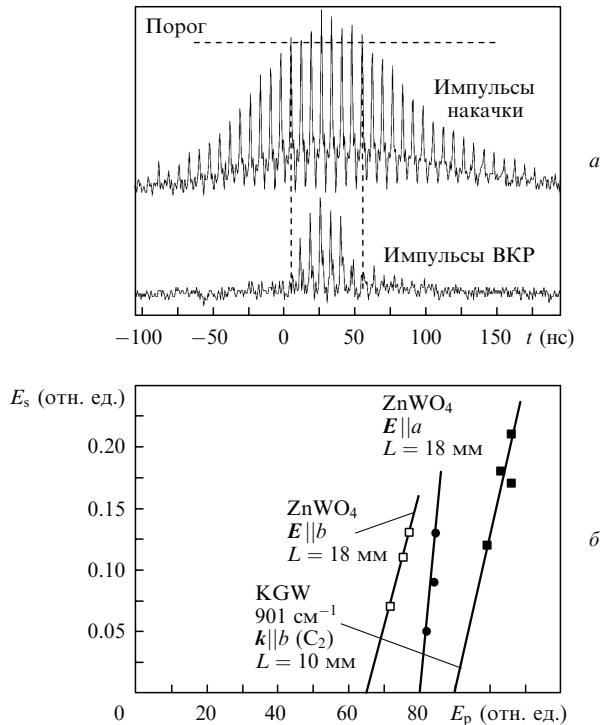


Рис.2. Осциллографмы излучения лазера накачки и ВКР в кристалле ZnWO₄ (а) и зависимости энергии выходных импульсов ВКР от энергии импульсов накачки для кристаллов ZnWO₄ и KGW (б).

Мы возбуждали ВКР в кристаллах пикосекундными импульсами лазера с пассивной синхронизацией мод на кристалле Nd: YLF. Лазер генерировал цуги импульсов длительностью $T_p = 22$ пс на длине волны излучения $\lambda = 1047$ нм (рис.2,а). Цуг импульсов состоял из ~ 20 импульсов с плавно изменяющейся амплитудой. Одномодовое излучение лазера фокусировалось сферическим длиннофокусным ($f = 70$ см) зеркалом в нелинейный кристалл, и измерялись временные, энергетические и спектральные параметры излучения. Возбуждение ВКР в монокристалле ZnWO₄ осуществлялось нами вдоль оси c кристалла моноклинной структуры длиной 18 мм. Вектор E линейной поляризации накачки в одном случае совпадал с осью b (C_2), в другом – с осью a . Для сравнения проводилось измерение параметров ВКР в кристалле KGd(WO₄)₂ длиной 10 мм при возбуждении резонанса на 901 см⁻¹. В этом случае возбуждение ВКР было направлено вдоль оси b , а вектор поляризации возбуждающего света совпадал с осью a .

Излучение ВКР в кристалле ZnWO₄ возникает на частоте 906 см⁻¹ стоксовой компоненты. На рис.2,а представлены осциллографмы импульсов накачки и ВКР, полученные от одной вспышки лазера. Цуг импульсов ВКР значительно короче цуга импульсов накачки. Отчетливо наблюдается порог возникновения и срыва ВКР. Откладывая энергию импульсов ВКР E_s по оси ординат, а энергию импульсов накачки E_p по оси абсцисс, мы получаем зависимости (рис.2,б), которые позволяют определить пороговую энергию импульсов накачки E_{th} . Эти зависимости получены при относительно слабой накачке в отсутствие каскадной генерации высших стоксовых компонент. Для сравнения на рис.2,б показана измеренная в тех же условиях зависимость эффективности ВКР (со стоксовым частотным сдвигом 901 см⁻¹) для кристалла KGd(WO₄)₂.

При стационарном режиме усиления, когда длительность импульса накачки значительно больше времени дефазировки ($T_p/T_2 \gg 1$), инкремент усиления в условиях неистощенной накачки пропорционален интенсивности накачки I_p и длине нелинейного взаимодействия L : $G_0 = gI_pL$, где g – стационарный коэффициент усиления. Пороговое значение инкремента G_0 достигается при интенсивности $I_{th} = E_{th}/(\tau S)$, соответствующей E_{th} (S – площадь сечения пучка, τ – длительность импульса накачки). Параметр $E_{th}L$ характеризует ВКР-усиление. Благодаря большей длине кристалла ZnWO₄ (18 мм) E_{th} в нем оказался ниже, чем в кристалле KGW (10 мм). В то же время нормированный энергетический порог $E_{th}L$ для кристалла ZnWO₄ при поляризации накачки $E \parallel b$ больше нормированного порога для кристалла KGW в 1.3 раза, а коэффициент ВКР-усиления для ZnWO₄ соответственно меньше, чем для KGW. Отношение пороговых параметров $E_{th}L$ для исследуемых кристаллов оказалось близким к 1.4 – отношению пиковых сечений КР, т. е. коэффициенты усиления в обоих кристаллах определяются пиковыми сечениями КР. Это указывает на стационарный характер процесса ВКР в обоих кристаллах при возбуждении импульсами длительностью 22 пс.

Используя измеренные значения нормированных пороговых энергий $E_{th}L$ и ранее измеренную величину $g = 5.1$ см/ГВт для кристалла KGW [11], мы определили коэффициенты стационарного ВКР-усиления для ZnWO₄ для двух поляризаций возбуждения (см. табл.2). Полученные нами для кристалла ZnWO₄ коэффициенты ВКР-усиления варьируются в зависимости от поляризационных условий возбуждения от 3.9 до 3.2 см/ГВт. Для кристалла ZnWO₄ коэффициенты ВКР-усиления несколько меньше, чем для других оксидных кристаллов [11]. Тем не менее кристалл ZnWO₄, имеющий малое время оптической дефазировки ($T_2 = 1.4$ пс), представляется нам перспективным для получения пикосекундных ВКР-импульсов в ближней ИК спектральной области [13].

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых (грант № МК-816.2010.2) и РФФИ (грант № 10-02-00254-а).

1. Басиев Т.Т. УФН, **169**, 1149 (1999).
2. Basiev T.T., Osiko V.V., Prokhorov A.M., Dianov E.M. *Topics Appl. Phys.*, **89**, 351 (2003).
3. Basiev T.T., Powell R.C., in *Handbook of Laser Technology and Applications* (Bristol, Philadelphia: IOP Publ., 2004, Ch. B 1.7, p. 469).
4. Филиппенко О.С., Победимская У.А., Белов Н.В. *Кристаллография*, **18**, 163 (1968).
5. Fomichev V.V., Kondratov O.I. *Spectrochim. Acta*, **50A**, 1113 (1994).
6. Basiev T.T., Sobol A.A., Zverev P.G., Osiko V.V., Powell R.C. *Appl. Opt.*, **38**, 594 (1999).
7. Basiev T.T., Sobol A.A., Zverev P.G., Ivleva L.I., Osiko V.V., Powell R.C. *Opt. Mater.*, **11**, 307 (1999).
8. Basiev T.T., Sobol A.A., Voron'ko Yu.K., Zverev P.G. *Opt. Mater.*, **15**, 205 (2000).
9. Kaminskii A.A., Eichler H.J., Ken-ichi Ueda, et al. *Appl. Opt.*, **38**, 4533 (1999).
10. Луканин В.И., Чунаев Д.С., Карасик А.Я. *Письма в ЖЭТФ*, **91**, 615 (2010).
11. Басиев Т.Т., Зверев П.Г., Карасик А.Я., Осико В.В., Соболь А.А., Чунаев Д.С. *ЖЭТФ*, **126**, 5 (2004).
12. Carman R.L., Shimizu F., Bloembergen N., et al. *Phys. Rev. A*, **2**, 60 (1970).
13. Chunaev D.S., Karasik A.Ya. *Laser Phys.*, **16**, 1668 (2006).